REC'D	2 4	JUN	2004	
WIPC	)			PCT

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) 【PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人		
の告類記号 P3468PC790	今後の手続きについては、様式]	PCT/IPEA/416を参照すること。
	国際出願日 (日.月.年) 16.04.20	[(日.万.年) 20.04.2003
国際特許分類 (IPC) Int. Cl'	H01M4/02, H01M4/	04, H01M4/48, H01M10/40
出願人 (氏名又は名称) 住友チタニウム株式会社		
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条) の	がたに作べ去打する。	た国際予備審査報告である。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を 3. この報告には次の附属物件も添付され a 附属書類は全部で		_ ページからなる。
補正されて、この報告の基礎 囲及び/又は図面の用紙 (P	とされた及び/又はこの国際予備 CT規則70.16及び実施細則第6	審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範)7号参照) 顕の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの
b 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示すよ ブルを含む。(実施細則第80	うに、コンピュータ読み取り可能 2号参照)	(電子媒体の種類、数を示す)。 な形式による配列表又は配列表に関連するテー
	ちの基礎 なは産業上の利用可能性についての な如 に規定する新規性、進歩性又は産 なび説明 大	P国際予備審査報告の不作成 業上の利用可能性についての見解、それを裏付
国際予備審査の簡求哲を受理した日 16.04.2004	国際予備審査	吸告を作成した日 27.05.2004
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番:	3号 木村	(権限のある職員) 4X 3132 孔一 3-3581-1101 内線 3477
<del></del>	O CALIBRA	, しし0ェーエエUI 内線 3477 l

第1 欄 報告の基礎	<b>国が国際番号 FCT/JF2004/005527</b>
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除く	ほか、国際出願の言語を基礎とした。
この報告は、  語による翻訳	とを基礎とした
これは、次の目的で提出された翻訳文の音語で	7 本ス
PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調 PCT規則12.4にいう国際公開	<u>查</u>
PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備報	
	•
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第 た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、	6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され
	この報告に旅付していない。)
X 出願時の国際出願書類	
明細書 .	
第ページ、	出願時に提出されたもの
第ページ*、 第ページ*、	一 付けで国際予備審査機関が受理したもの
請求の範囲	一 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第	出願時に提出されたもの
第	PCT19条の規定に基づき補正されたもの
第	付けで国際予備審査機関が受理したもの
	一 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 一 ページ/図、	Harristan draw a
第ページ/図*、	出願時に提出されたもの
第ページ/図*、	
配列表又は関連するテーブル	,
配列表に関する補充欄を参照すること。	·
3. ] 補正により、下記の魯類が削除された。	
明細魯第	~-·>
□ 請求の範囲 第 □ 図面 第	
配列表 (具体的に記載すること)	ページ/図
□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載	けること)
4. 二 この報告は、補充欄に示したように、この報告	に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を越
えてされたものと認められるので、その補正が	に称りされかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を越 されなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
□ 明細書 第	ページ
配列表(具体的に記載すること)	ページ/図
□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載	すること)
•	
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と爺	こ入されることがある。

## 特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/005527

見解		
新規性(N)	・ 請求の範囲1-17 請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-17</u> 請求の範囲	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-17</u> 請求の範囲	

(文献一覧) 文献 1: JP 2002-373653 A (信越化学工業株式会社),2002.12.26,全文 文献 2: JP 2001-226112 A (信越化学工業株式会社),2001.08.21,全文 文献 3: JP 2001-210319 A (三洋電機株式会社),2001.08.03,全文 文献 4: JP 10-50312 A (セイコーインスツルメンツ株式会社),1998.02.20,全文文献 5: JP 2002-42809 A (電気化学工業株式会社),2002.02.08,全文

## (備考)

請求の範囲1-17に係る発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。真空蒸着若しくはスパッタリングにより形成された珪素酸化物の薄膜を集電体の表面に有するリチウム工作者による場合には、日本の大きな大きないである。 負極は、国際調査報告で引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にと って自明なものでもない。